

ERL計画推進室報告

2017年1月12日

河田洋

- cERLの運転について
- 来年度予算について
- EUV-FEL Workshop

cERLの運転について

cERL建設打合せで集中議論

- 予算係にも2月20日から冷却を開始し、3月13日の週から3週間運転をする事を了解してもらっている。
- 運転の成果を上げるべく、準備を進めておいて頂きたい。

現在のcERLの位置付けと今後

- KEKロードマップからERLの次期光源の位置付けが削除
- KEK Project Implementation Plan (KEK-PIP)

<http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20160802141100/>

その中に、ERLに関しては、以下の記述

3-2. Other research projects carried out using general funds of KEK

The following projects have up to now been conducted mainly using general funds of KEK. They will be continued on the condition that greater efforts are made to obtain external funding.

- Simulation studies with the existing supercomputer (only up to summer of 2017)
- [Industrial application of ERL technology](#)
- Participation in CERN LHC/ATLAS
- Research carried out in the Detector Technology Project
- Research in the Japan-US cooperation program
- Projects under the Toshiko Yuasa Laboratory (TYL)
- Small-scale research projects conducted in KEK institutes

来年度予算について

- PIPの文言、および科研費等の研究成果を上げるための運転および開発を進める必要があることを説明し、予算要求を先端部として出す(1月11日の先端部打合せで岡田部長から指示)。
- 基本的には今年度の維持費＋追加予算による運転経費程度を要求し、来年度1月以降のSKEKBの運転期に合わせてcERLの運転を要求するのが現実的と考えている。
- 1月25日の先端部打合せで予算案を先端部内部で議論する予定。
- 1月20日(金曜日)までに各グループの予算要求を送って頂きたい。

EUV-FEL Workshopを開催

日時: 12月13日(火曜日)

場所: 秋葉原UDX 4F NEXT1



100名を超える参加者
約70%が関連企業関係者

http://pfwww.kek.jp/PEARL/EUV-FEL_Workshop/

EUV-FEL WORKSHOP
ワークショップ
WORKSHOP

加速器科学が拓く革新的イノベーション
～半導体 LSI 製造プロセス用 EUV 光源をめざして～

参加費 無料
定員 120名

開催 2016 12.13 Tue 10:00-17:00

web 申込み先
申込み締切: 12月7日(水)まで
QRコード
http://www.kek.jp/pearl/next1/

開催場所
秋葉原 UDX 4F 「NEXT-1」
QRコード
http://www.udx.jp/access.html

お問い合わせ
高エネルギー加速器研究機構
研究支援総務課
大学・産業連携推進室
TEL.029-879-6239

基調講演
「Big Data時代のCognitive Computingに向けたNeuromorphic Device」
"Neuromorphic devices for Cognitive Computing in Big Data era"
IBM 東京基研研究所 サイエンス＆テクノロジー 部長 新田博康氏 山道 新太郎 氏
IBM Japan Senior Manager Shintaro Yamada

招待講演
「半導体量産回路の微細化とEUVリソグラフィ」
"Scaling of Semiconductor Integrated Circuits and EUV Lithography"
ASML アジアプロセス基盤開発センター 代表取締役社長 石内 秀美 氏
IBEC President Hidemichi Ishino

「EUV Lithography Industrialization and future outlook」
ヨーロッパエレクトロニクス株式会社 テクノロジーデベロップメントセンター ディレクター 宮崎 順二 氏
ASML Japan Co., Ltd. Technology Development Center Director Junji Miyazaki

主催: EUV-FEL 光源産業化研究会、高エネルギー加速器研究機構 共催: 産業技術総合研究所 後援: TIA

JSTの予算要求に関する情報

- 平成29年度新規事業「未来社会創造事業」
(探索加速型)のテーマ提案募集

<http://www.jst.go.jp/mirai/index.html>